

## Niskociśnieniowy system plazmowy V10-G

### Wydajny system wsadowy do usuwania fotorezystu



Niskociśnieniowy system plazmowy V10-G jest wyposażony w przesuwane drzwi i komorę procesową wykonaną ze szkła kwarcowego i nadaje się również do czyszczenia płytek.

System wsadowy V10-G jest przeznaczony do usuwania fotorezystu. Ponadto może być optymalnie stosowany do czyszczenia płytek.

#### Obszary zastosowań

- Idealny system do usuwania warstw fotorezystu (również SU-8) po procesach suchych, takich jak wytrawianie RIE lub wiązką jonów, a także po procesach implantacji z dużą dawką
- Płytki silikonowe lub inne czyszczenie podłoża przed obróbką na mokro w celu uzyskania lepszej zwilżalności w celu uzyskania jednolitego i wydajnego wyniku
- Ma zastosowanie do procesów w MEMS i nanotechnologii
- Usuwanie polimerów m.in. po procesach Boscha
- Usuwanie organicznych warstw ofiarnych
- Kondycjonowanie związków bioaktywnych

#### Cechy systemu

- Komora procesowa: szkło kwarcowe
- Drzwi przesuwane
- Sterowanie PLC: SPS (S7-300)
- Rezystancyjny panel dotykowy z systemem operacyjnym Windows (obsługa również w rękawiczkach)
- Obsługa automatyczna i ręczna
- Wyświetlanie wszystkich istotnych parametrów procesu
- Indywidualna autoryzacja dostępu poprzez grupy użytkowników
- Archiwizacja wszystkich procesów
- Zdalna konserwacja (VPN)
- Interfejs ethernetowy

#### Opcje

- Pompa próżniowa
- Pułapka ozonowa
- Do dwóch dodatkowych wlotów gazu
- Miękki start i powolne odpowietrzanie
- Klatka Faradaya
- Zawór regulacji ciśnienia procesowego

#### Dane techniczne

Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.): 720 x 820 x 820 mm

Wymiary komory (Ø x D): 215 x 260 mm

Częstotliwość wzbudzenia plazmy: Mikrofale (2.45 GHz)

Moc mikrofal: 50-600 W

Wloty gazu z regulatorem masowego przepływu: 1 kanał

Zasilanie: 400 V, 50 / 60 Hz

Pobór mocy (bez pompy próżniowej): 1.5 kVA

Wakuometr: Pirani

Waga: 150 kg

